

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 野毛 悟 副委員長 廣瀬文彦

幹事 小館淳一・岩田展幸 幹事補佐 坂本 尊・中村雄一

日時 10月5日(水) 13:00~16:20

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 光記録技術・電子材料, 一般

1. 金属層をインターカレートした二層グラフェンの作製と電気特性
○倉金夏己・星野 峻・櫻井亮太・山岸多門・永田知子・岩田展幸・山本 寛(日大)
2. 自由電子レーザー照射下で成長させた単層カーボンナノチューブのカイラリティ制御及び電気特性
○保延賢人・川口大貴・石川翔梧・永田知子・岩田展幸・山本 寛(日大)
3. Si基板上へのMnGa(001)配向膜の作成とイオン照射による磁気パターンニング
○石川 徹・根来 翼・福田憲吾・大島大輝・加藤剛志・岩田 聡(名大)
4. 有機金属分解法を用いたMo置換Coフェライトの作製と評価
○猪狩知樹・目黒 療(長岡技科大)・柳原英人・喜多英治(筑波大)・石橋隆幸(長岡技科大)
5. 磁気ホログラムの回折効率に向けた磁気アシスト記録条件の検討
○白樫 善・河津航大・後藤太一・高木宏幸・中村雄一・林 攀梅・内田裕久・井上光輝(豊橋技科大)
6. 磁性ガーネット/SiO₂多層膜構造を用いた体積磁気ホログラムの特性改善
○河津航大・白樫 善・後藤太一・高木宏幸・中村雄一・林 攀梅・内田裕久・井上光輝(豊橋技科大)
7. 空間フィルタの位置制御によるホログラフィックメモリシステムのトレランス緩和技術
○田中幸修・井手達朗・橋爪滋郎(日立)

☆CPM研究会今後の予定 []内発表申込締切日

11月18日(金), 19日(土) 金沢工大扇が丘キャンパス〔締切済〕テーマ:機能性材料(半導体, 磁性体, 誘電体, 透明導電体・半導体等)薄膜プロセス/材料/デバイス, 一般

11月28日(月)~30日(水) 立命館大大阪いばらきキャンパス〔締切済〕テーマ:デザインガイア2016—VLSI設計の新しい大地—

12月12日(月), 13日(火) 京大桂キャンパス〔未定〕テーマ:窒化物半導体・光電子デバイス・材料, 関連技術及び一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

坂本 尊 (NTT)

TEL [046] 240-4531, FAX [046] 270-2323

E-mail: sakamoto.tak@lab.ntt.co.jp